

Title (en)
Room with controlled amounts of dust

Title (de)
Raum mit geregelter Entstaubung

Title (fr)
Salle à empoussièrement contrôlé

Publication
EP 0787950 A1 19970806 (FR)

Application
EP 97400049 A 19970110

Priority
FR 9601120 A 19960131

Abstract (en)
The room is in the form of a closed chamber (2) with at least two opposite walls (3,5). The first wall has blowers (4) which blow a gas, e.g. air, with a controlled dust level into the room. The second one has extractors (6). The first wall has blowers in two or more separate sections (3A,3B,3C) in which the dust levels are uniform but different. The second wall has extractors to seal with the air from each of the sections. The walls with the blowers and extractors can be the two opposite vertical walls of the room or they can be the ceiling and the floor. The air drawn out by the extractors can be recycled. The different sections of the room can be separated by opaque partitions made from a flat and smooth material. This reduces the possibility of particle retention, while the blowers are equipped with active carbon filters.

Abstract (fr)
La présente invention concerne une salle à empoussièrement contrôlé présentant une enceinte fermée (2), comportant au moins deux parois opposées (3, 5), la première desdites parois (3) étant munie de moyens de soufflage (4) susceptibles de souffler dans ladite salle (1) un fluide gazeux, notamment de l'air, présentant un empoussièrement déterminé contrôlé, et la seconde paroi (5) étant munie de moyens d'évacuation (6) susceptibles d'évacuer le fluide gazeux soufflé dans ladite salle (1). Selon l'invention, ladite première paroi (3) est divisée en au moins deux secteurs de soufflage (3A, 3B, 3C), les moyens de soufflage (4) de chacun desdits secteurs de soufflage (3A, 3B, 3C) soufflant un fluide gazeux qui présente un empoussièrement uniforme, mais différent de l'empoussièrement de l'autre secteur de soufflage. <IMAGE>

IPC 1-7
F24F 3/16

IPC 8 full level
F24F 3/16 (2006.01)

CPC (source: EP US)
F24F 3/167 (2021.01 - EP US)

Citation (search report)
• [A] FR 2417372 A1 19790914 - HAUVILLE FRANCOIS [FR]
• [A] US 5350336 A 19940927 - CHEN HSING-HAI [TW], et al
• [A] US 5259812 A 19931109 - KLEINSEK DON A [US]
• [A] GB 2147409 A 19850509 - HITACHI LTD, et al

Cited by
US5972060A; WO9815782A1

Designated contracting state (EPC)
DE GB IT

DOCDB simple family (publication)
EP 0787950 A1 19970806; FR 2744042 A1 19970801; FR 2744042 B1 19980410; US 5704833 A 19980106

DOCDB simple family (application)
EP 97400049 A 19970110; FR 9601120 A 19960131; US 79132897 A 19970131